

CVD-1200 系统由开启式单（双）温区管式炉、高真空分子泵系统、压强控制仪及多通道高精度数字质量流量控制系统组成。可实现真空达 0.001Pa 混合气体化学气相沉积和扩散试验。

主要功能和特点:

- 1、高真空系统由双级旋片真空泵和分子泵组成，最高真空可达 0.0001Pa；
- 2、可配合压强控制仪控制气体压力实现负压的精准控制；
- 3、数字质量流量控制系统是由多路质量流量计，流量显示仪等组成，实现气体的流量的精密测量和控制；每条气体管路均配备高压逆止阀，保证系统的安全性和连续均匀性。
- 4、采用 KF 快速法兰密封，装卸方便快捷；管路采用世界顶级 Swagelok 卡套连接，不漏气；
- 5、超温、过压时，自动切断加热电源及流量计进气，使用安全可靠。

主要用途:

高校、科研院所、工矿企业做高温气氛烧结、气氛还原、CVD/ CVI 实验，特别适用于真空镀膜、纳米薄膜材料制备、纳米线生长、电池材料干燥烧结等场所。

主要技术参数:

SKGL-1200	控温方式	采用人工智能调节技术，具有 PID 调节、自整定功能，并可编制 30 段升降温程序。
	加热元件	0Cr27Al7Mo2
	工作电源	AC220V 50HZ/60HZ
	额定功率	4KW
	炉管尺寸	Φ 60/Φ 80/Φ 100*1000mm
	工作温度	≤1150℃
	最高温度	1200℃
	恒温精度	±1℃
	加热区长度	440mm 或 220mm/220mm
升温速度	≤20℃/min	

	密封方式	不锈钢快速法兰挤压密封
ZK-F	真空范围	0.1-0.001Pa
	极限真空	4.0*10 ⁻⁴ Pa
	产品配置	双级旋片真空泵+分子泵
	测量方式	复合真空计
	真空规管	电阻规+电离规
	冷却方式	风冷
	工作电源	AC220V 50/60HZ
	抽速	110L/S
ZDFC-III	测量范围	5~1*10 ⁻⁵ Pa
	稳压(真空)范围	1~5*10 ⁻³ Pa
	压力(真空)稳定精度)	±3%
	控制范围	2.5*10 ⁻³ ~1*10 ⁻⁴ Pa
	控制精度	± 1%
HQZ-III	控制方式	D07-7K 质量流量计,D08 流量显示仪
	流量规格	0-500SCCM /0-1SLM, (可根据客户要求配置)
	线性	±1%F.S
	准确度	±1%F.S
	重复精度	±0.2%F.S.
	响应时间	≤2sec
	耐压	3MPa
	气路通道	3 通道 (根据客户需求)
	针阀	316 不锈钢

管道	Φ 6mm 不锈钢管
接口	SwagelokΦ 6mm

